

# 金碳镀膜机 (配合SEM使用)

产品名称	金碳镀膜机 (配合SEM使用)
公司名称	成都鑫弋科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	丹顿:1 100:1 美国:1
公司地址	黄金路1号
联系电话	87335465 13458609644

## 产品详情

### 产品概述

丹顿真空设计、制造了数以千计的蒸发、溅射、PECVD镀膜系统，产品广泛应用于精密光学、眼视光学、微电子/半导体、光电、通讯、医疗器械等领域的科学研究、产品开发和规模生产。作为美军工指定制造商，丹顿真空生产制造的所有镀膜设备在质量、性能、可靠性等方面均符合美军工标准并获得CE/UL/CSA等国际认证。

### 蒸发镀膜系统

#### Integrity 系列

- Explorer14

Integrity 蒸发系统：丹顿真空历史最长的产品，广泛应用于半导体，微电子，光电子，光学等领域。系统真空室的直径范围从660mm到2m，配置灵活，稳定可靠。可以配置多种蒸发源、辅助离子源和光学/石英晶体膜厚监控，控制系统界面友好，易学易用。系统坚固耐用，维修率低。目前国内有Integrity各种型号设备共计14台

#### INTEGRITY 蒸发系统

Integrity 镀膜设备系列是丹顿真空历史最长的产品，应用于精密光学以及半导体，微电子等行业镀膜。丹顿真空一直是新技术的倡导者和实践者：

开发美国最早的商用电子枪

## 离子辅助镀膜技术应用的先驱

## 自动控制技术开发应用的先驱

丹顿Integrity蒸发镀膜系统可为您提供一个功能强大、配置灵活的镀膜平台，并提供充分的选择以满足您特定的应用要求

### 系统技术规格

真空室尺寸：系统真空室直径从26"（660mm）到80"（2032mm）。

泵系统：机械泵+扩散泵或低温泵，深冷系统（防返油及提高抽速）可选。

蒸发源：多种型号270度电子枪以及电源（3KW，6KW，10KW），电阻蒸发源。

离子源：丹顿真空CC-105宽束冷阴极离子源或客户指定离子源。

工装系统：标准行星式，钟罩式，Knusden式以及特殊要求的夹具，如可自动翻面夹具。

光学膜厚监控系统：丹顿真空LambdaPro光学膜厚监控系统，波长范围350nm到2000nm可选。

晶体膜厚控制系统：IC5，XTC/2，MDC360可选，探头形式有单探头，双探头或六探头可选。

自动控制：全自动计算机控制或PLC(可编程逻辑控制器)触摸屏控制可选。

### 磁控溅射系统

#### Discovery

- Explorer
- Desk Pro

Discovery 磁控溅射系统：丹顿真空为满足研究机构研发及小规模生产的双重要求而开发的系统，自15年前推出以来，现已有超过100台Discovery磁控溅射系统遍布在世界许多著名企业和科研机构，比如摩托罗拉、英特尔等。Discovery系列产品的真空室规格从460mm到890mm。目前在国内有Discovery各种型号设备共计14台。

#### DISCOVERY 磁控溅射台

丹顿真空的Discovery系列在世界许多著名的研究机构得到广泛的应用，是业内公认的灵活、可靠的磁控溅射系统。从15年前开发以来，该系统已经销售超过100台，在国内销售12台。

Discovery系列适合于研发及小批量生产。系统采用独特的共焦溅射结构，能够使用较小的磁控溅射靶枪在较大的面积的工件上得到较好的均匀性（例如：采用传统的垂直溅射方式，为了在6英寸工件上得到±5%的均匀性，需要使用8英寸直径靶枪，而采用共焦溅射方式，则可以采用3英寸磁控溅射靶枪，即可达到同样的均匀性指标）。因此在同样的要求下，采用的靶枪及电源相对较小，所以能够降低设备成本及运行成本，同时，丹顿真空也提供传统的垂直溅射方式系统。

Discovery系列都可以安装多个磁控溅射靶枪，可以实现多种溅射模式，包括直流/射频/脉冲溅射，共溅射，射频偏压溅射；可以实现三级加热，最高加热温度可以达到900

° C；可以配置进样室（单片或多片），最大可以处理的工件直径可以达到 250mm；系统真空室规格从18英寸（457mm）到 35英寸（890mm）可选；高真空采用分子泵或低温泵获得；可以采用PLC触摸屏控制系统或计算机控制系统。

#### 系统技术规格：

- 标准真空室直径为635mm 和785mm ，并提供客户化设计，最大真空室直径达到890mm。Discovery 635标准工件盘尺寸为8"，Discovery 785可以处理最大直径达10"的基片；
- 多靶直流/射频磁控溅射，标准635系统最多可以装配四个靶，785系统最多可以装六个靶，靶枪高度可调，角度可调靶枪可选。可提供充分的工艺灵活性（直流/射频/脉冲溅射，共溅射）；
- 旋转式基片台，射频偏压台可选，提供基片预清洗及射频刻蚀和射频偏压溅射；
- 工件盘加热采用特殊的三级加热，最高可以对基片加热到900 ° C；
- 全自动单片或多片（8片）进样室（满足较大批量生产需求），Discovery 785可以配备大型进样室，最大可传送直径700mm，重达50磅的传送盘。
- 高真空泵采用低温泵或涡轮分子泵，保证工艺环境清洁；
- 全自动控制，界面友好，操作简单直观。可以实现远程控制或远程技术支持和远程故障排查；
- 工艺室采用前开门设计，便于靶材、工件装卸；
- 丰富的工艺技术经验和及时的技术支持；